

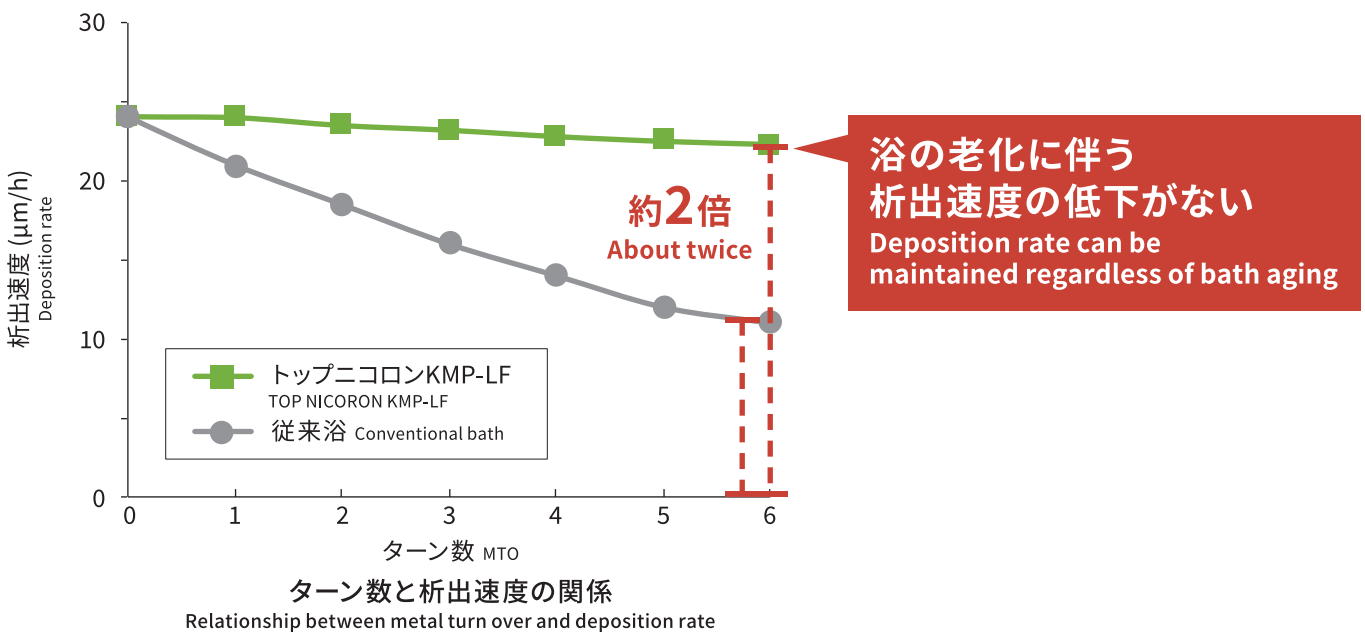
トップニコロンKMP-LF

TOP NICORON KMP-LF

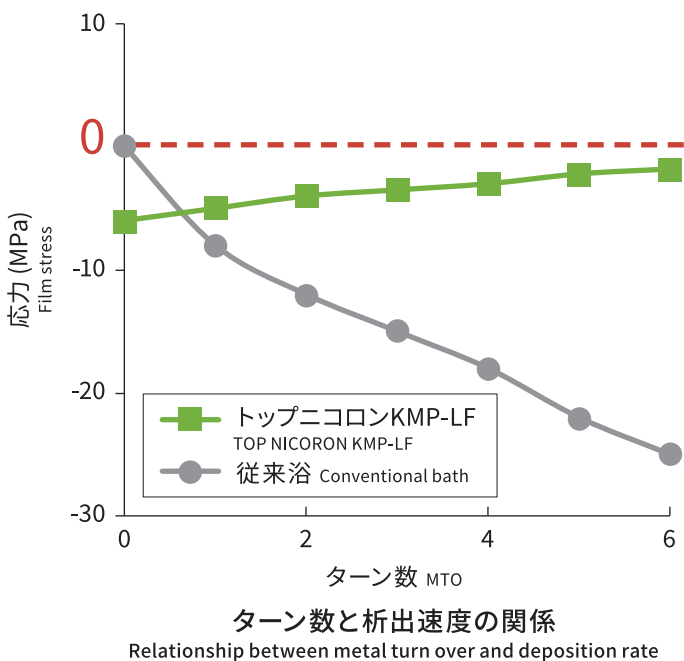
析出速度の高い無電解ニッケルめっき液 Electroless Nickel Plating Solution for High Deposition Rate

- 析出速度が高く、連続使用しても速度が低下しない
High deposition rate, can keep deposition rate continuously
- 皮膜応力が低く、連続使用による応力の変化が小さい
Low film stress, film stress change is suppressed

安定した析出速度 Stable deposition rate



低い皮膜応力 Low film stress



高い析出速度 High deposition rate

